DGKK-Arbeitskreis "Herstellung und Charakterisierung von massiven Halbleiterkristallen" am 8./9. Okt. 2014 in Freiberg

Defektlumineszenz in 4H-SiC

<u>Daniel Kaminzky</u>, B. Kallinger, P. Berwian, J. Friedrich (Fraunhofer IISB)

S. Oppel, M. Schütz (Intego Vision Systeme)





D. Kaminzky Materialien / SiC / Fraunhofer IISB 8./9. Okt. 2014, Freiberg © Fraunhofer IISB

- Motivation
- Photolumineszenz
- Vorstellung PL-Defektlumineszenzscanner
- Photolumineszenzmessungen an 4H-SiC Epitaxieschichten
- Zusammenfassung
- Ausblick

Page 2 D. Kaminzky Materialien / SiC / Fraunhofer IISB 8./9. Okt. 2014, Freiberg © Fraunhofer IISB



Motivation

SiC in der Leistungselektronik

Leistungsfähigkeit von SiC-Bauelementen kann durch strukturelle und kristallographische Defekte in Epitaxieschichten begrenzt sein

- Stapelfehler
- Basalflächenversetzungen
- (threading dislocations)



Bipolardegradation in 4H-SiC p-i-n Diode [1]

Etablierte Charakterisierungsmethoden:

- > Defektselektives Ätzen (nicht zerstörungsfrei)
- > Synchrotron Röntgentopographie (zeitaufwändig, kostenintensiv)
- UV-PL (zerstörungsfrei, schnell, hochauflösend, abbildendes Verfahren, keine Probenpräparation, Mapping des gesamten Wafers)

Page 3 D. Kaminzky Materialien / SiC / Fraunhofer IISB 8./9. Okt. 2014, Freiberg © Fraunhofer IISB



Photolumineszenz : Phys. Grundlagen

Photolumineszenz:

- > Anregung durch Absorption von Photonen ($hv > E_q$)
- Erzeugung von Elektronen-Loch-Paaren
- Rekombination: Direkt oder über Zwischenniveaus in der Bandlücke
- Nicht strahlende bzw. strahlende Rekombination (Lumineszenz)
- Defekte als strahlende bzw. nichtstrahlende Rekombinationszentren
- Defektspezifische PL-Wellenlänge (Spektraler Fingerabdruck)





Photolumineszenz

Untersuchung der Photolumineszenz an Defekten in SiC

Mehrere Arbeitsgruppen:

- Messaufbauten f
 ür Forschungszwecke
- Lokale Untersuchung
- Mapping des ges. Wafers mehrere Stunden
- Grundlagenforschung

Fraunhofer IISB und Intego:

- Entwicklung eines kommerziellen, anwendungsorientierten Tool zur Defektcharakterisierung an SiC
 - > UV-PL-Defektlumineszenzscanner

Page 5 D. Kaminzky Materialien / SiC / Fraunhofer IISB 8./9. Okt. 2014, Freiberg © Fraunhofer IISB

[4] Tajima et al., APL 86, 061914 (2005)
[5] Nagano et al., JJAP 52, 04CP09-1 (2013)
[6] Stahlbush et al, MSF 556-557 (2007) p 295-298





Messprinzip: Defektlumineszenzscanner

Schematischer Aufbau und Kenndaten



> UV-Laser: 325 nm (cw)

- Eindringtiefe: ca. 8 μm
- EMCCD-Kamera (400 1000 nm)
- Objektiv: x2,5 (x5,0)
- Bandpassfilter:
- λ = 450 ± 40 nm
- λ = 540 ± 40 nm
- > Langpassfilter: $\lambda > 590$ nm
- > x-y-Tisch (bis zu 6'')
- Laterale Aufl.: 5 μm
- Messdauer: 10 30 min



Page 6 D. Kaminzky Materialien / SiC / Fraunhofer IISB 8./9. Okt. 2014, Freiberg © Fraunhofer IISB

Messprinzip: Defektlumineszenzscanner

Geräteaufbau im FhG-Reinraum



Page 7 D. Kaminzky Materialien / SiC / Fraunhofer IISB 8./9. Okt. 2014, Freiberg © Fraunhofer IISB



Typisches PL-Mapping an epitaktischem n-4H-SiC (defektbehaftet)



Diverse strukturelle Auffälligkeiten → Klassifizierung

Page 8 D. Kaminzky Materialien / SiC / Fraunhofer IISB 8./9. Okt. 2014, Freiberg © Fraunhofer IISB



Dunkle Dreiecksdefekte (Stapelfehler) mit Basalflächenversetzungen



Panchromatisch

- Stapelfehler als Dreiecke
- Dunkles Zentrum
- Helle Kanten und Nukleationsort
- Gestörter Bereich um Dreiecksdefekte
- Helle feine Linien zeigen Basalflächenversetzungen
- Helle parallele Linien (senkrecht zur Stufenflussrichtung): Wachstumsstufen



Page 9 D. Kaminzky Materialien / SiC / Fraunhofer IISB 8./9. Okt. 2014, Freiberg © Fraunhofer IISB

Helle Dreiecksdefekte (Stapelfehler)



Panchromatisch

- Dunkler stabförmiger Bereich mit hellen dreiecksförmigen Bereichen
- Mehrere helle Bereiche entlang eines Defektes
- Überlagerung von mehreren Stapelfehlern möglich

Page 10 D. Kaminzky Materialien / SiC / Fraunhofer IISB 8./9. Okt. 2014, Freiberg © Fraunhofer IISB



Stabförmige Defekte (Stapelfehler)



Panchromatisch

- Stapelfehler als dunkler stabförmiger Bereich
- Heller dreiecksförmiger Bereich am Nukleationsort
- Anderes Erscheinungsbild als "Dreiecksdefekte"

Page 11 D. Kaminzky Materialien / SiC / Fraunhofer IISB 8./9. Okt. 2014, Freiberg © Fraunhofer IISB



Ringförmige Defekte



Panchromatisch

- > Heller ringförmiger Bereich
- Eingewachsene Partikel oder Mikroröhren
- Nukleationsort für
 Dreiecksdefekte (Stapelfehler)

Page 12 D. Kaminzky Materialien / SiC / Fraunhofer IISB 8./9. Okt. 2014, Freiberg © Fraunhofer IISB



"Reisförmige" Defekte



Panchromatisch

- Helles "reisförmiges" Zentrum mit dunkler Umrandung
- Vorzugsorientierung
- Ähnliche Defekte aus Literatur bekannt (threading dislocations?)

Page 13 D. Kaminzky Materialien / SiC / Fraunhofer IISB 8./9. Okt. 2014, Freiberg © Fraunhofer IISB



Linienhafte Defekte



Panchromatisch

- Helle Linienhafte Defekte mit dunkler Umrandung
- Keine Vorzugsorientierung, willkürliche Anordnung
- Vermutlich Kratzer?

Page 14 D. Kaminzky Materialien / SiC / Fraunhofer IISB 8./9. Okt. 2014, Freiberg © Fraunhofer IISB



Facette



Panchromatisch

- Hellerer Bereich an Facette im Vergleich zur Umgebung
- > Dotierungsinhomogenität?

Page 15 D. Kaminzky Materialien / SiC / Fraunhofer IISB 8./9. Okt. 2014, Freiberg © Fraunhofer IISB



Wellenlängenspezifische Photolumineszenz



400-1000 nm

410-490 nm

510-590 nm

540-740 nm

Page 16 D. Kaminzky Materialien / SiC / Fraunhofer IISB 8./9. Okt. 2014, Freiberg © Fraunhofer IISB



Zusammenfassung

Untersuchung der Defektlumineszenz in 4H-SiC Epitaxieschichten

- Implementierung eines Defektlumineszenzscanners für SiC (Prototyp)
 - > Anwendungsorientiert, vollflächig, "state-of-the-art" inline Charakterisierungstool
- Klassifizierung unterschiedlicher struktureller Epidefekte
 - Diverse Stapelfehler (Dunkle bzw. helle Dreiecke und Balken)
 - > Mikroröhren, eingewachsene Partikel
 - Basalflächenversetzungen
 - > Threading dislocations (einzeln bzw. Netzwerke)
 - > Dotierungsinhomoginitäten
 - Kratzer
 - Ungeklärte Auffälligkeiten

Untersuchungen zur spektralen Defektcharakteristik

Spektraler Fingerabdruck spezieller Defekttypen (optische Filter)



Ausblick

Technische Verbesserungen und weitere Untersuchungen

Upgrade Defektlumineszenzscanner:

- Beleuchtungsquellen f
 ür untersch. Anregungswellenlängen
 - Eindringtiefe (Untersuchung Defektursprung und Tiefe)
- Automatisierte Defektauswertung und -klassifizierung
- Homogenisierungsoptik (Rauschunterdrückung)
- Dunkel- und Hellfeldbeleuchtung (Lichtmikroskop)
- Hochauflösendes Mikroskop (5x, 10x, …)
- Zusätzl. Filter: >750 nm, 900 ± 5 nm
- Korrelationen zwischen PL-Mappings und...
 - Lichtmikroskop-Mappings (Dreiecksdefekte, Partikel, Makrodefekte)
 - > Lebensdauer Messungen (Auswirkung auf effektive Lebensdauer)
 - KOH-geätzten Proben (TDs, BPDs)
 - Zeitaufgelöste-PL (spektral aufgelöste Messungen)



Page 18 D. Kaminzky Materialien / SiC / Fraunhofer IISB 8./9. Okt. 2014, Freiberg © Fraunhofer IISB

Ausblick

Einfluss von Punktdefekthaushalt auf PL von Versetzungen



Wie gewachsen

Keine Auffälligkeiten in UV-PL

Thermisch behandelt

Abbildung von Stufen- und Schraubenversetzungen

Punktdefekthaushalt beeinflusst Photolumineszenz von Versetzungen



Studien zur thermischen Oxidation und Ausheilung am IISB

Page 19 D. Kaminzky Materialien / SiC / Fraunhofer IISB 8./9. Okt. 2014, Freiberg © Fraunhofer IISB

Ichikawa et al., APE 5, 101301 (2012)



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

Diese Arbeit ist Teil des SiCWinS-Projekts und wird durch die Bayrische Forschungsstiftung (BFS) finanziert (AZ-1028-12).



Bayerische Forschungsstiftung

Fraunhofer

Page 20 D. Kaminzky Materialien / SiC / Fraunhofer IISB 8./9. Okt. 2014, Freiberg © Fraunhofer IISB